



即時發表

經辦代理:

David Moreno (大衛穆銳農)

Open Sky Communications

電話: +1-415-519-3915

電郵: dmoreno@openskypr.com

艾司摩爾(ASML)加盟 THE EBEAM INITIATIVE

eBeam Initiative 在半導體光罩和微影供應鏈公司中，達到 50 個會員的新里程碑

聖荷西，加州，美國，二零一九年二月二十六日—The eBeam Initiative，一個致力於推廣和宣導電子束技術在半導體製造全新應用的團體，今天宣佈，ASML 正式加盟 eBeam Initiative。作為世界領先晶片製造儀器商，ASML 將為 eBeam Initiative 在半導體光罩和微影供給鏈的教育活動帶來寶貴的觀點。

2009 年，the eBeam Initiative 正式成立，旨在半導體設計和製造業界為電子束技術的教育平臺上加強呼籲。the eBeam Initiative 利用年度會員感受調查和光罩製造商的意見調查來確定重要的趨勢以幫助並引導業界在新電子束技術的引進與支持上前行。能達到 50 個會員的里程碑，the eBeam Initiative 將持續它的契約宗旨來加強業界的聯盟，促進電子束技術整體生態發展。

今天，在聖荷西舉辦的 SPIE 先進微影技術會議 (Advanced Lithography Conference) 期間，the eBeam Initiative 的年度午餐會同期舉行，ASML 資深副總裁曹宇 (Dr. Yu Cao) 博士；HJL Lithography 的哈利. 萊文森博士 (Dr. Harry Levinson)；D2S 產品首席官及行政副總裁龐琳勇博士 (Dr. Leo Pang) 將在午餐會上做主題講演。三位業界名人會涉獵有關電子束相關，且含蓋光罩製造和微影未來成功的題目上，包括：EUV 微影模擬；GPU 加速深度學習在光罩的模擬應用；以及機器學習在運算微影上的應用。講演稿將於二月二十六日後上傳到 the eBeam Initiative 網址：www.ebeam.org.

“ASML 將會提供非常有價值的視角，” D2S 執行長藤村 (Aki Fujimura) 先生表示，D2S 是 eBeam Initiative 的主辦管理公司。“ASML 在微影製程模型和模擬以及電子束測量和檢驗上（通過併購 HMI）擁有獨特的技術。ASML 的加入擴展了對光罩刻寫的測量和檢驗，及運算微影上的瞭解。為了電子束技術創新的持續發展，對於像 the eBeam Initiative 類似的整個業界合

作努力的需求，就變得非常重要。我們非常高興並歡迎 ASML 成為我們使命的最新貢獻者，為了加速電子束技術在全新半導體製造領域的合作提供幫助。”

關於 The eBeam Initiative (電子束倡議團)

The eBeam Initiative 是一個致力於推廣和宣導電子束技術在半導體製造全新應用的團體；為有關電子束技術的教育和促進活動提供相應的論壇。TheeBeam Initiative 的目標是增加電子束技術應用在半導體製造各領域中的投資；降低電子束技術應用的障礙，能夠使更多積體電路設計完成，並且更快投進市場成為可能。

會員公司, 涵蓋整個半導體生態系統，包括:aBeam Technologies; Advantest; Alchip Technologies; AMTC; Applied Materials; Artwork Conversion; AseltaNanographics; ASML; Cadence Design Systems; Canon; CEA-Leti; D2S; Dai Nippon Printing; EQUIcon Software GmbH Jena; eSilicon Corporation; Fraunhofer CNT; Fujitsu Semiconductor Limited; GenISys GmbH; GLOBALFOUNDRIES; Grenon Consulting; Hitachi High-Technologies; HOLON CO., LTD; HOYA Corporation; imec; IMS CHIPS; IMS Nanofabrication AG; JEOL; KLA; Maglen; Mentor, a Siemens Business; Multibeam Corporation; NCS; NuFlare Technology; Petersen Advanced Lithography; Photonics; Sage Design Automation; Samsung Electronics; Semiconductor Manufacturing International (Shanghai) Corporation (SMIC); STMicroelectronics; Synopsys; tau-Metrix; Tela Innovations; Tokyo Electron Ltd. (TEL); TOOL Corporation; Toppan Printing; Toshiba; UBC Microelectronics; Vistec Electron Beam GmbH; Xilinx and ZEISS.The eBeam Initiative 歡迎所有電子工業的公司和協會加盟。細節請查看 www.ebeam.org.

###